

光酸発生剤量の削減

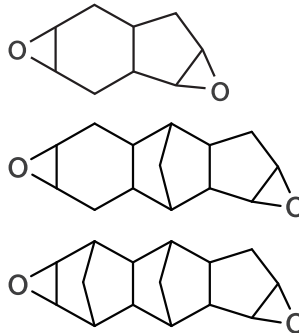
Reduction of PhotoAcid Generators

EPOCHALIC添加で、高価かつ金属腐食の懸念がある酸発生剤の低減が可能です

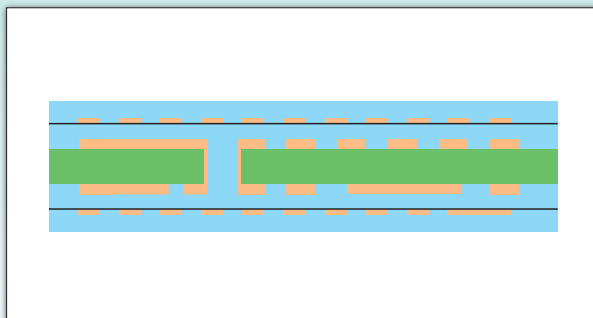
EPOCHALIC can reduce photoacid generators, which are expensive and may cause metal corrosion.

期待される効果 Effects

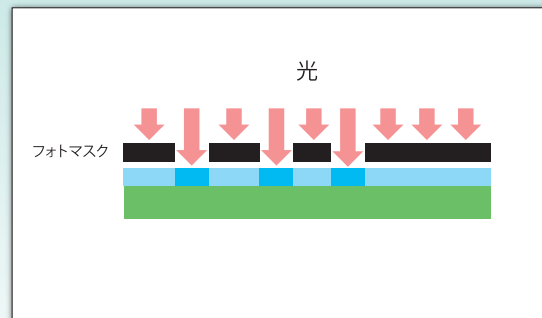
- ◎コストダウン
Cost Reduction
- ◎金属腐食の抑制
Suppression of metal corrosion



想定用途 Applications



層間絶縁膜
interlayer dielectric



レジスト
Resist

光酸発生剤量・露光量と硬化 Relationship between photoreaction and acid generator/exposure amount

酸発生剤の低減例 (DE-102)

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| エポキシ | DE-102 | - | - | - | 50 | 50 | 50 |
| | 他社品A | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 光酸発生剤 | CPI-200K | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1 |
| 露光量 [mJ/cm ²] | | 506 | 506 | 506 | 497 | 497 | 497 |
| 硬化有無 (指触試験) | | × | △ | △ | △ | △ | ○ |

※ ○：硬化、△：表面に効果膜形成、×：液状のまま

低酸発生剤時の露光量低減効果

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|------|------|-----|------|------|
| 当社エポキシ | THI-DE | - | - | 100 | - | - |
| | DE-102 | - | - | - | 30 | - |
| | DE-103 | - | - | - | - | 30 |
| 汎用エポキシ | BisA型エポキシ | 100 | - | - | - | - |
| | 他社品A | - | 100 | - | 70 | 70 |
| 光酸発生剤 | CPI-200K | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 露光量 [mJ/cm ²] | | 1447 | 1447 | 62 | 1447 | 1190 |
| 硬化有無 (指触試験) | | △ | △ | ○ | ○ | ○ |

※ ○：硬化、△：表面に効果膜形成、×：液状のまま

